

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】令和 4 年 7 月 26 日 (2022.7.26)

【公開番号】特開 2022-31758 (P2022-31758A)

【公開日】令和 4 年 2 月 22 日 (2022.2.22)

【年通号数】公開公報 (特許) 2022-032

【出願番号】特願 2021-188807 (P2021-188807)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/027(2006.01)

G 0 3 F 7/004(2006.01)

C 0 8 G 59/17(2006.01)

C 0 8 F 290/14(2006.01)

H 0 5 K 3/28(2006.01)

10

【F I】

G 0 3 F 7/027 5 1 5

G 0 3 F 7/004 5 1 2

G 0 3 F 7/004 5 0 5

C 0 8 G 59/17

C 0 8 F 290/14

H 0 5 K 3/28 D

G 0 3 F 7/004 5 0 1

20

【手続補正書】

【提出日】令和 4 年 7 月 15 日 (2022.7.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

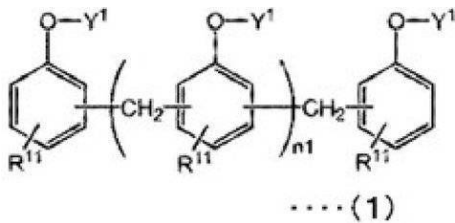
【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(A) 酸変性ビニル基含有エポキシ樹脂、(B) エチレン性不飽和結合を有する光重合性モノマー、(C) 光重合開始剤及び (D) 無機フィラーを含有してなる感光性樹脂組成物であり、(A) 成分の酸変性ビニル基含有エポキシ樹脂が、下記一般式 (1) で表されるノボラック型エポキシ樹脂であるエポキシ樹脂 (a) と、ビニル基含有モノカルボン酸 (b) とを反応させて得られる樹脂 (A') に、飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物を反応させて得られる樹脂 (A'') (ただし、 M_w / M_n (重量平均分子量 / 数平均分子量) で表される分散度が 2.0 ~ 5.0 のもの。また、o-クレゾールノボラック樹脂とアクリル酸とを反応させた後、テトラヒドロ無水フタル酸を反応させてなる樹脂、及び o-クレゾールノボラック樹脂とアクリル酸とペンタエリスリトールトリアクリレート・無水コハク酸付加物とを反応させた後、無水コハク酸及びテトラヒドロ無水フタル酸と反応させてなる樹脂を除く。) を含み、かつ、(A) 酸変性ビニル基含有エポキシ樹脂の含有量が全固形分量に対して 15 ~ 60 質量% であり、(D) 無機フィラーの含有量が全固形分量に対して 30 ~ 70 質量% である感光性樹脂組成物。

40

【化 1】



〔一般式(1)中、R¹¹は水素原子又はメチル基を示し、Y¹は水素原子又はグリシジル基を示し、n¹は1以上の整数を示す。なお、複数存在するR¹¹及びY¹はそれぞれ同一でも異なってもよい。但し、少なくとも一つのY¹はグリシジル基を示す。〕

10

【請求項 2】

(B) エチレン性不飽和結合を有する光重合性モノマーが、エチレン性不飽和結合を1分子内に3つ以上有する多官能光重合性モノマーである請求項1に記載の感光性樹脂組成物。

【請求項 3】

更に(E) 顔料を含む請求項1又は請求項2に記載の感光性樹脂組成物。

【請求項 4】

支持体と、請求項1～3のいずれか一項に記載の感光性樹脂組成物から形成された感光層とを備える、感光性フィルム。

20

【請求項 5】

絶縁基板と前記絶縁基板上に形成された回路パターンを有する導体層とを備える積層基板の前記絶縁基板上に、前記導体層を覆うように請求項1～3のいずれか一項に記載の感光性樹脂組成物を用いて感光層を積層し、前記感光層の所定部分に活性光線を照射して露光部を形成し、次いで、前記感光層の前記露光部以外の部分を除去することを特徴とする、レジストパターンの形成方法。

【請求項 6】

絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成された回路パターンを有する導体層と、前記導体層を覆うように請求項1～3のいずれか一項に記載の感光性樹脂組成物を用いて形成された永久レジスト層とを備えるプリント配線板。

30

40

50